



دانشکده فنی مهندسی  
گروه برق(الکترو نیک)

جلسه دفاع از پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق - الکترونیک

عنوان:

بررسی اثر تغییرات فشار پرس و دمای سینترینگ روی خواص الکتریکی وریستورها  
بر پایه ZnO آلایش یافته با اکسید لانتانیم (La)

استاد راهنما:

دکتر محمد مهدی کارخانه چی

پژوهشگر:

محمد علی رخش ماه

زمان: ۱۳۸۷/۷/۲۸ ساعت: ۱۱/۳۰ صبح

مکان: سمعی و بصری

لَبِّيْكَ يَعْلَمُ  
لَبِّيْكَ يَعْلَمُ

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتكارات و  
نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه  
متعلق به دانشگاه رازی است.



دانشکده فنی مهندسی  
گروه برق(الکترو نیک)

## پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش الکترونیک

### عنوان پایان نامه

بررسی اثر تغییرات فشار پرس و دمای سینترینگ روی خواص الکتریکی وریستور ها بر  
پایه ZnO آلایش یافته با اکسید لانتانیم La

استاد راهنما:

دکتر محمد مهدی کارخانه چی

استاد مشاور :

دکتر مصطفی علی شیرین پور فرخاد

نگارش:

محمد علی رخش ما

مهر ماه ۱۳۸۷



دانشکده فنی مهندسی  
گروه برق (الکترو نیک)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش الکترونیک

نام دانشجو محمد علی رخش ما ه

### عنوان پایان نامه

بررسی اثر تغییرات فشار پرس ودمای سیسترینگ روی خواص الکتریکی وریستور ها  
بر پایه ZnO آلایش یا فته با اکسید لانتانیم

در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۸ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه عالی به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای دکتر محمد مهدی کار خانه چی با مرتبه ای علمی استادیار امضاء

۲- استاد مشاور دکتر مصطفی علی شیرین پور فرخاد با مرتبه ای علمی دانشیار امضاء

۳- استاد داور داخل گروه دکتر حسین شیسی با مرتبه ای علمی استادیار امضاء

۴- استاد داور خارج از گروه دکتر سید محمد الهی با مرتبه ای علمی دانشیار امضاء

## سپاسگزاری

به نام دوست که هر چه داریم همه از لطف اوست. اوست نخستین اندیشه گری که با نور خود افلاک را درخشنان ساخت. سپاس و حمد خداوند مهریان که علم و دانش را عطیه ای برای انسان قرار داد تا بتواند در پرتو آن گامی در جهت شناخت حقایق بردارد. خداوند را شاکرم که لطف و توفیق خود را به من ارزانی کرد، تا بتوانم این پایان نامه را به اتمام برسانم و با توجه به روایت "بار خدایا به تو پناه می برم از دانشی که بهره ندهد." بتوانم نتایج تلاشم را در جهت ارایه دانش به نسلهای آینده در سنگر تعلیم و تربیت و ارایه فن در شاخه صنعت داشته باشم. در این راستا وظیفه خود می دانم که از راهنمایی پسر ارشد و بیشتر ائمه استاد محترم خودم دکتر محمد مهدی کارخانه چیزی به عنوان استاد راهنمای که در طول تحصیل از محضر علم و اخلاقشان کسب فیض نموده ام، و دکتر مصطفی علی شیرین پور فرخاد به عنوان استاد مشاور که عهدار هدایت این پایان نامه بودند و در به ثمر رساندن آن زحمات فراوان را متحمل شده اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. و نیز از دکتر سید محمد الهی داوری خارج گروه و استاد علم و ادب جناب دکتر حسین شیسی که زحمت داوری داخل گروه را تقبل نمودند، قدردانی می نمایم.

از تمامی عزیزانی که مرا در انجام پژوهش یاری فرمودند ، علی الخصوص مسئولین آزمایشگاههای سرامیک، شیمی معدنی ، XRD ، SEM و همچنین مسئولین سایت اینترنتی دانشگاه تبریز تشکر می نمایم.

**حاصل ذهبات پایان نامه ام را تقدیم می نمایم :**

به

**کلیه دوستداران علم و دانش**

و به والدین ارجمندم که در پرورش و آموزش فرزند خود از هیچ کوششی دریغ نورزیدند بعد به همسر و فادرم که در من انگیزه حرکت کردن را ایجاد کرد و همیشه پشتیبانیم هست و به فرزند خردسالم آیین که دوری پدر را همواره تحمل می نماید.

## چکیده

وریستورها ابزارهای الکتریکی هستند. که مقاومت الکتریکی آنها با تغییر ولتاژ تغییر می کند. و از ذرات اکسید روی که توسط یک لایه اکسید عایق از هم جدا شده اند تشکیل یافته‌اند. مشخصه شدیداً غیر خطی را از خود بروز می دهند. به عنوان محافظ مدار در برابر ولتاژ های بزرگ ناخواسته و ناگهانی استفاده می‌شوند. وریستورهای اکسید روی آلایش یافته با پلیمرها امروزه به عنوان برق‌گیر در خطوط انتقال و توزیع نیرو به کار می‌برند. اکثراً عناصر خاکی نادر به عنوان اکسید وریستورساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهه اثر تغییرات فشار پرس و دمای سینترینگ روی خواص الکتریکی وریستور اکسید روی آلایش یافته با اکسید لانتانیم مورد بررسی قرار گرفت.

برای ساخت وریستور، اکسید های روی ، پرائسیدیمیوم ، کبالت ، کروم به ترتیب با درصدهای X-۹۷٪، ۰٪/۵ ، ۱٪، ۰٪ و لانتانیم با مقادیر مختلف ۰٪/۵ ، ۱٪/۵ ، ۰٪/۵ مولی بکار برده‌اند. در روند تحقیق، هر کدام از مواد را به مقدار معین به صورت پودر با هم مخلوط کردیم و بعد از ۱۲ ساعت آسیاب در هاون در دمایی ۶۵°C به مدت ۲ ساعت تکلیس شده و پس از آن طیف XRD ترکیب را تهیه نمودیم. سپس قرص‌ها را به مدت ۵ ساعت آسیاب کرده و به اندازه ۳ درصد وزنی پودر اولیه چسب PVA اضافه می‌کنیم. بعد عمل گرانول صورت گرفت که دوازده نمونه قرص وریستور به قطر ۱۳ mm در دو فشار ۴ و ۶ تن (شش قرص در فشار ۴ تن و شش قرص دیگر در فشار ۶ تن) در دو دمای ۱۳۰۰ °C و ۱۳۵۰ °C به مدت ۲ ساعت در هوا باز پخت شدند. که در فشار ۴ تن به علت هماهنگ نبودن فشار و دما باعث شد که در حین سینترینگ دانه‌ها رشد بهتری پیدا نکنند و نیز ناهمنگ بودن مرزهای دانه‌ای و اندازه دانه‌ها جریان نشته را زیاد نمود. بنابراین از شش قرص در فشار ۴ تن نتیجه مطلوب نگرفتیم. میزان تخلخل قرصها محاسبه و اندازه گیری الکتریکی انجام گرفت. و تصاویر SEM آنالیز از سطوح قرص‌ها تهیه شد و میانگین اندازه دانه‌ها محاسبه گردید.

نتیجه اینکه با افزایش غلظت  $\text{La}_2\text{O}_3$  به تدریج خواص غیرخطی و ولتاژ شکست وریستور کاهش می‌یابد و جریان نشته وریستور افزایش پیدا می‌کند. و تعداد مرزدانه‌ها کاهش می‌یابد بهترین دمای سینترینگ در مقایسه با دیگر مقالات هم ردیف  $1300^\circ\text{C}$  با میزان غلظت ۰٪/۵ مولی در فشار ۶ تن می‌باشد.

## مخفف ها یا کوتاه نوشته ها

bcc	body-centred cubic structure
BF	bright-field
BLT	$\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_2$
BSE	backscattered electrons
CBED	convergent beam electron diffraction
CC	charge-collection
CCD	charge-coupled device
CM	combination of conductive
DF	dark-field
EBIC	electron beam induced curvent
EBSP	electron back scattered pattern
EDS	energy-dispersiv X-ray spectrometry
EELS	electron energy-loss spectrometry
ESEM	environmental scanningelectron microscopy
FEG	field-emission gun
GIF	Gatan imaging filter
GSE	gaseous secondary electrons
HAADF	high-angle annular dark-field
hcp	hexagonal close-packed structur
HP	Hewlett Packard
HREE	heavy rare earth element (Eu-LU)
IF	Radio frequency
LREE	light rare earth elements(La-sm)
mol.%	mole percent
ppm	part permillion
PSZ	partially stabilized zirconia
PVA	polyvinyl alcohol
PF	Poole - Frenkel
R,(T)	Surface resistance as a function of tempranue T
RCAST	(Japan, Tokyo U.)Research Cnter for Advanced Science and Technology
RE	Rare earth element (such as La,Nd ,Sm,Eu,Gd,etc.)
RE -123 Oxides	123compound fonnend whid a rare earthinstead of yttrium
REE	rare earth elements
SAD	selected area electron diffraction
SE	secondary electrons
SEM	Scanning electron microscope
SSA	Speci fic surface area
STEM	scanning transmission electron microscopy
T	Tesla( unit)
TEM	transmission electron microscopy
TG	Thermo gravimetry
XRD	X-ray diffraction electron microscope
ZnO	Zinc oxide varistor

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	سپاسگزاری
	تقدیرنامه
	چکیده
	مخفف ها یا کوتاه نوشته ها
۱.....	پیشگفتار.....
	فصل اول: بررسی منابع و ریستورها
۳.....	۱-۱- مقدمه
۴.....	۲-۱- روی و اکسید روی.....
۴.....	۲-۲-۱- ساختمان روی
۵.....	۲-۲-۲-۱- اکسید روی
۵.....	۲-۲-۳- ساختار بلوری اکسید روی .....
۶.....	۴-۲-۱- روش‌های تهیه اکسید روی .....
۷.....	۴-۲-۱- محدودیت ها .....
۷.....	۶-۲-۱- کاربردهای اکسید روی .....
۸.....	۳-۱- عناصر خاکی نادر.....
	۴-۴- لانتانیم و اکسید لانتانیم
۹.....	۱-۴- ۱- ساختمان لانتانیم .....
۱۰.....	۲-۴-۱- عوامل مراقبتی لانتانیم .....
۱۱.....	۳-۴-۱- عوامل محیطی لانتانیم .....
۱۱.....	۴-۴-۱- اکسید لانتانیم .....
۱۳.....	۴-۵-۱- روش‌های تهیه اکسید لانتانیم .....
۱۳.....	۶-۴-۱- ساختمان بلوری اکسید لانتانیم .....
۱۴.....	۷-۴-۱- کاربرد اکسید لانتانیم .....
	۵-۱- کروم و اکسید کروم
۱۴.....	۱-۵-۱- ساختمان کروم .....
۱۶.....	۲-۵-۱- اکسید کروم و ساختمان بلوری آن .....
	۶-۱- کبالت و اکسید کبالت
۱۷.....	۱-۶-۱- ساختمان کبالت .....
۱۸.....	۲-۶-۱- اکسید کبالت و ساختمان بلوری آن .....

۷-۱	- پراسئودیمیوم و اکسید پراسئودیمیوم
۲۰	۱-۱-۷-۱ ..... پراسئودیمیوم
۲۰	۱-۲-۷-۱ ..... کاربرد پراسئودیمیوم
۲۱	۱-۳-۷-۱ ..... ایزو توپها
۲۲	۱-۴-۷-۱ ..... اکسید پراسئودیمیوم
۲۳	۸-۱ ..... PVA - چسب
	فصل دوم : آشنایی با وریستور
	۲-۱- تعاریف و مفاهیم
۲۵	۲-۱-۱-۱-۲ ..... وریستورها
۲۶	۲-۱-۲- مشخصات و منشاء سورجها
۲۸	۲-۳-۱-۲- جریان نشتی
۲۹	۲-۴-۱-۲- مشخصه ولتاژ - جریان وریستور
۳۱	۲-۵-۱-۲- ولتاژ شکست
۳۲	۲-۶-۱-۲- ضریب غیر خطی
۳۴	۲-۷-۱-۲- وریستور آرمانی
	۲-۲- توصیف وریستورها و انواع آن
۳۴	۲-۱-۲-۲- انواع وریستورها از نظر ولتاژ
۳۵	۲-۲-۲-۲- مدار معادل
۳۸	۲-۳-۲-۲- کاربرد
۴۰	۲-۴-۲-۲- تغییر رسانایی با فشار
۴۲	۲-۵-۲-۲- خرابی وریستور
۴۲	۲-۶-۲-۲- سوراخ شدن وریستور
۴۳	۲-۷-۲-۲- ویژگیهای وریستور برای انتخاب
۴۳	۲-۳-۲- ریز ساختار وریستورها
۴۴	۲-۱-۳-۲- فازها در ریز ساختار
۴۵	۲-۲-۳-۲- مرز دانه ها در ریز ساختار
۴۶	۲-۳-۳-۲- میکرو سکوپ
۴۹	۲-۴-۳-۲- تاثیر افزودنیها در ریز ساختار وریستور های اکسید روی
۵۰	۲-۵-۳-۲- اثر افزودنیها بر خواص الکتریکی وریستور های اکسید روی
۵۲	۲-۴-۲- تئوریهای رسانش وریستورها
۵۲	۲-۱-۴-۲- مدل سد شاتکی
۵۴	۲-۴-۲- مدل های ابتدایی

الف) مدل شکست بهمنی

- ب) جریانهای محدود شده بار فضایی  
 ج) فعال سازی حرارتی بر روی یک سد شاتکی دوگانه  
 د) تونل زنی ساده

### فصل سوم: پژوهش در پیشینه و ریستورها

۵۷.....	۱-۳ - مقدمه
۵۷.....	۲-۳ - مراحل آماده سازی
۵۹.....	۳-۳ - روشهای آماده سازی پودر و ریستور
۶۲.....	۴-۳ - ریستورهای $ZnO-Pr_6O_{11}$
۶۲.....	۱-۴-۳ - ریستورهای $ZnO-Pr_6O_{11}-CoO-Mg_2O_3$
۶۴.....	۲-۴-۳ - ریستورهای $ZnO-Pr_6O_{11}-CoO-Cr_2O_3-La_2O_3$
۶۶.....	۳-۴-۳ - ریستورهای $ZnO-Pr_6O_{11}-CoO-Cr_2O_3-Er_2O_3$
۶۷.....	۴-۴-۳ - ریستورهای $ZnO-Pr_6O_{11} Y_2O_3$ آلایش یافته
۶۷.....	۴-۴-۳ - ریستورهای $SnO_2-Co_2O_3-Ta_2O_3-La_2O_3$

### فصل چهارم: مواد و روش‌ها و کارهای آزمایشگاهی

#### ۱-۴ - ترکیبات ریستور و محاسبات مربوط به ساخت

۷۴.....	۱-۱-۴ - وزن کردن مواد اولیه
۷۶.....	۲-۴ - مخلوط نمودن پودرها
۷۶.....	۳-۴ - تکلیس سازی
۷۷.....	۴-۴ - الگوی پراش اشعه ایکس (طیف XRD) نمونه‌ها و آنالیز آن
۸۱.....	۵-۴ - فشار و باز پخت
۸۲.....	۶-۴ - تخلخل
۸۳.....	۷-۴ - الکترود گذاری
۸۳.....	۸-۴ - آزمایشات الکتریکی
۸۴.....	۱-۸-۴ - اندازه گیری الکتریکی
۸۶.....	۲-۸-۴ - ولتاژ شکست و ضریب غیر خطی
۸۸.....	۹-۴ - عکس برداری SEM
۹۷.....	۱۰-۴ - مشاهدات و نتایج تجربی
۹۸.....	۱۱-۴ - پیشنهادات
۹۸.....	۱۲-۴ - پیوست‌ها
۱۰۳.....	۱۳-۴ - منابع و مأخذ
۱۰۹.....	۱۴-۴ - چکیده انگلیسی

## فهرست شکل ها

صفحه

شماره و عنوان شکل ها

	فصل اول :
۳..... مقایسه بین بلورهای سیلیسیوم کاربید و اکسید روی	-۱-۱
۵..... تصویری از سنگ روی	-۲-۱
۵..... پودر اکسید روی	-۳-۱
۶..... ساختمان بلوری اکسید روی	-۴-۱
۸..... کانی خاکی نادر	-۵-۱
۱۰..... کانی فلز لانتانیم	-۶-۱
۱۰..... مدل نقطه ای آرایش الکترونی لانتانیم	-۷-۱
۱۱..... پودر اکسید لانتانیم	-۸-۱
(a) ریزنگار اسکنر الکترون فیلم $\text{La}_2\text{O}_3$ روی شیشه (بزگسازی $\times ۲۵۰۰$ )	-۹-۱
(b) تغییرات ضخامت با دما و با تعداد کل افشارانک $\text{cc}$	
(c) نقشه $\log \rho$ در برابر ( $T / 1000$ ) فیلم $\text{La}_2\text{O}_3$	
(d) منحنی I-V اکسید لانتانیم / سل پلی ارید / سلول c در (a) (تیره	
۱۲..... (b) زیر نور با شدت $1000 \text{ mw/cm}^2$	-۱۰-۱
۱۴..... ساختمان بلوری اکسید لانتانیم	-۱۱-۱
۱۵..... مدل نقطه ای آرایش الکترونی کروم	-۱۲-۱
۱۶..... پودر اکسید کروم	-۱۳-۱
۱۶..... ساختمان بلوری تری اکسید کروم	-۱۴-۱
۱۷..... مدل نقطه ای آرایش الکترونی کبالت	-۱۵-۱
۱۸..... تصویری از کانی کبالت	-۱۶-۱
۱۸..... پودر اکسید کبالت	-۱۷-۱
۱۹..... ساختمان بلوری اکسید کبالت	-۱۸-۱
۱۹..... (a) تصویر SEM ریز ساختار $\text{Co}_3\text{O}_4$ (b) ساختار دیواره عنصر $\text{O}_4$	-۱۹-۱
۲۰..... کانی عنصر پراسئودیمیم	-۲۰-۱
۲۱..... مدل نقطه ای آرایش الکترونی پراسئودیمیم	-۲۱-۱
۲۲..... پودر اکسید پراسئودیمیم	-۲۲-۱
۲۲..... ساختمان کریستالی اکسید پراسئودیمیم	-۲۳-۱
۲۳..... ساختار شیمیائی و پودرچسب PVA	

## فصل دوم :

۱-۲- (a) طرز قرار گرفتن وریستور در مدار	
۲۶.....(b) نمودار ولتاژ ورودی و خروجی در وریستور	
۲۷.....۲-۲- موج شکل تست رایج پیک ایمپالس	
۲۸.....۳-۲- شکل کلی ولتاژ نوسانی از القاء رعد و برق یا سوئیچ مدار	
۳۰.....۴-۲- نمودار مشخصات ولتاژ- جریان وریستور اکسید روی	
۳۳.....۵-۲- منحنی اختلاف ضربی غیر خطی با جریانهای مختلف	
۳۴.....۶-۲- تغییرات ضربی خطی با چگالی	
۳۵.....۷-۲- نمودار مدار معادل وریستور	
۳۶.....۸-۲- ماده وریستور اکسید روی داخل بدنه سرامیک نصب شده است .	
۳۷.....۹-۲- تصاویری وریستورهای تجاری در حین ساخت و کاربرد	
۳۸.....۱۰-۲- وریستور برای حفاظت اتصالات دستگاه تقویت کننده	
۳۹.....۱۱-۲- وریستور برای حفاظت پل دیود	
۴۰.....۱۲-۲- وریستور برای حفاظت کلی	
۴۴.....۱۳-۲- دو نمونه از نمودار ریز ساختار وریستور	
۴۴.....۱۴-۲- سه نمونه از ریز ساختار وریستور اکسید روی	
۴۶.....۱۵-۲- یک نمونه پیکربندی میکروسکوپی استفاده شده برای هدایت	
۴۷.....۱۶-۲- تصاویر جریان القائی پرتو الکترونی مرز دانه وریستور	
۴۷.....(a) روشن- تاریک (b) روشن در یک خط (c) تاریک در یک خط کنتراس	
۴۸.....۱۷-۲- تصاویر جریان القائی (a) یک انحنای مرز دانه (b) سطح کوچک قابل دید مرز دانه	
۴۸.....۱۸-۲- وجود اختلاف جریان القائی یک خطی مرز دانه را در وریستور نشان می دهد.	
۴۹.....۱۹-۲- میکروگراف SEM وریستور اکسید روی با افزودنیها :	
(a) سینترینگ اکسید آلومینیوم در دمای $1050^{\circ}\text{C}$ به مدت یک ساعت	
(b) اکسید کبالت در سینترینگ $1100^{\circ}\text{C}$	
۵۲.....(c) ریز ساختار در وریستور ZPCCD	
۵۴.....۲۰-۲- دیاگرام باند انرژی سد شاتکی مضاعف پلی کریستالین در مرز دانه نیمه هادیها	

## فصل سوم :

۵۸.....-۱-۳- دیاگرام آماده سازی وریستور	
۵۹.....-۲-۳- مراحل آماده سازی وریستور	
۶۱.....-۳-۳- فلوچارت تاریخچه تهیه وریستورهای اکسید روی	
۶۳.....-۴-۳- منحنی J-E وریستور های $\text{Dy}_2\text{O}_3$ با ZPCCD	
۶۳.....-۵-۳- آنالیز EDX با ۵٪/۰ مول $\text{ZnO}$ (a) مرز دانه (b) دانه (c) لایه بین دانه	
۶۵.....-۶-۳- منحنی J-E وریستورها برای دمای سینترینگ مختلف	

-۷-۳	میکروگراف واریستور مقدار مختلف $Tb_4 O_7$
۶۶	..... مول (a) ..... ۰٪/۰٪ مول (b) ..... ۵٪/۰٪ مول (c) ..... ۰٪/۷۵ مول (d)
-۸-۳	تصاویر SEM و ریستور $SnO_2$ .... $x=1/00$ (d) $x=0/ 50$ (c) $x=0/25$ (b) $x=0/00$ (a)
-۹-۳	(a) ضریب غیر خطی و میدان الکتریکی به عنوان تابع $La_2O_3$
۷۰	(b) ویژگی های J-E در نمونه آلیده شده با تراکم مختلف $La_2O_3$
۷۱	- ارزش $InJ_{vs}$ در مقابل $E^{1/2}$ برای نمونه های دوب شده با تراکم مختلف $La_2O_3$
-۱۰-۳	(a) ثابت دی الکتریک نسبی در مقابل فرکانس نمونه الیده شده با تراکم مختلف $La_2O_3$
۷۲	(b) نبود دی الکتریک در مقابل فرکانس نمونه های دارای محتویات $La_2O_3$
فصل چهار :	
-۴-۴	طیف XRD پودر وریستور با غلظت ۰٪/۵ از $La_2O_3$ بعد از تکلیس.
۷۸	طیف XRD پودر وریستور با غلظت ۱٪ از $La_2O_3$ بعد از تکلیس.
۷۹	طیف XRD پودر وریستور با غلظت ۱٪/۵ از $La_2O_3$ بعد از تکلیس.
۸۰	پروفایل دمایی استفاده شده برای بازپخت ، نرخ افزایش و کاهش برابر ۵ و ۳ درجه سلسیوس در دقیقه است.
۸۱	
۸۴	- مدار مورد استفاده قرار گرفته شده در اندازه گیری الکتریکی
۸۵	- منحنی های مشخصه J-E با مقادیر مختلف $La_2O_3$ در دمای $1350^{\circ}C$ در فشار ۶ تن
۸۵	- منحنی های مشخصه J-E با مقادیر مختلف $La_2O_3$ در دمای $1300^{\circ}C$ در فشار ۶ تن
۸۷	- منحنی تغییرات ضریب غیر خطی بر حسب تغییرات غلظت $La_2O_3$
۸۷	- منحنی تغییرات ولتاژ شکست بر حسب تغییرات غلظت $La_2O_3$
۸۸	- منحنی تغییرات جریان نشتی بر حسب تغییرات غلظت $La_2O_3$
۹۱	- تصویر SEM مربوط به نمونه با میزان ۰٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۲	- تصویر SEM مربوط به نمونه با میزان ۱٪ مولی $La_2O_3$
۹۳	- تصویر SEM مربوط به نمونه با میزان ۱٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۴	- نتایج آنالیز مربوط به کل سطح نمونه با ۰٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۴	- نتایج آنالیز مربوط به دانه هادر نمونه با ۰٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۴	- نتایج آنالیز مربوط به مرزدانه هادر نمونه با ۰٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۵	- نتایج آنالیز مربوط به کل سطح نمونه با ۱٪ مولی $La_2O_3$
۹۵	- نتایج آنالیز مربوط به دانه هادر نمونه با ۱٪ مولی $La_2O_3$
۹۵	- نتایج آنالیز مربوط به مرزدانه هادر نمونه با ۱٪ مولی $La_2O_3$
۹۶	- نتایج آنالیز مربوط به کل سطح نمونه با ۱٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۶	- نتایج آنالیز مربوط به دانه هادر نمونه با ۱٪/۵ مولی $La_2O_3$
۹۶	- نتایج آنالیز مربوط به مرزدانه هادر نمونه با ۱٪/۵ مولی $La_2O_3$

## فهرست جدول ها

صفحه

شماره و عنوان جدول ها

فصل اول :

۶.....	- آنالیز عنصر و اندازه های اکسیداسیون
۱۳.....	- مشخصات اکسید لانتانیم
۱۶.....	- خصوصیات کرم
۲۱.....	- مشخصات پراسئودیمیم

فصل دوم :

۵۰ .....	- نقش افزودنیهای مختلف بر ریز ساختار وریستور اکسید روی
----------	--

فصل سوم:

۶۰.....	- روش‌های مختلف آماده سازی پودر وریستور
۶۴.....	- مشخصات منحنی V-پارامترهای دی الکتریکی وریستور یا مقادیر مختلف CoO
۶۵.....	- ریز ساختار منحنی V-وریستور ZPCCL برای دمای سینترینگ مختلف
۶۷.....	- ولتاژ شکست، ولتاژ مرز هر دانه، ضریب غیرخطی، جریان نشتی وریستور ZPCCE بر حسب دمای سینترینگ
۶۸.....	- ولتاژ شکست، ضریب غیرخطی و جریان نشتی وریستورهای Pr <sub>6</sub> O <sub>11</sub> شامل Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۶۹.....	- پارامترهای وریستور نمونه محتویات مختلف La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>

فصل چهارم:

۷۵.....	- مقادیر جرمی استفاده شده از مواد به ازای ۵٪ مولی اکسید لانتانیم (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
۷۵.....	- مقادیر جرمی استفاده شده از مواد به ازای ۱٪ مولی اکسید لانتانیم (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
۷۶.....	- مقادیر جرمی استفاده شده از مواد به ازای ۱/۵٪ مولی اکسید لانتانیم (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
۸۲.....	- داده های مربوط به میزان تخلخل
۸۶.....	- مشخصات الکتریکی وریستور ساخته شده از میزان غلظت های متفاوت La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۹۰.....	- اندازه دانه ها به ازای مقادیر مختلف غلظت La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۹۹.....	- داده ها در دمای بازپخت ۱۳۰۰°C با غلظت ۵٪ مولی La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در فشار ۶ تن
۱۰۰.....	- داده ها در دمای بازپخت ۱۳۰۰°C با غلظت ۱٪ مولی La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در فشار ۶ تن
۱۰۱.....	- داده ها در دمای بازپخت ۱۳۰۰°C با غلظت ۱/۵٪ مولی La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در فشار ۶ تن
۱۰۲.....	- داده ها در دمای بازپخت ۱۳۵۰°C با غلظت ۵٪ مولی La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در فشار ۶ تن
۱۰۳.....	- داده ها در دمای بازپخت ۱۳۵۰°C با غلظت ۱٪ مولی La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در فشار ۶ تن
۱۰۴.....	- داده های در دمای بازپخت ۱۳۵۰°C با غلظت ۱/۵٪ مولی La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> در فشار ۶ تن

## پشگفتار

الکترونیک عصری تازه بر صنعت قرن حاضر گشود و همچنان نیز طلیعه وار کاروان علوم است و در عین حال توسعه دستگاههای الکترونیکی جدید نه تنها با دیگر پیشرفت‌های جامعه همگام بوده بلکه از آن پیشی نیز گرفته است. همگامی با رشد بی وقهه تکنولوژی، مستلزم وقوف کامل بر ریشه‌های این حرکت سریع است. در این میان الکترونیک قدرت که به مطالعه مشخصه و عملکرد المانهای الکترونیکی می‌پردازد سهم بسزایی دارد چرا که سالیانه میلیونها دلار صرف واردات این المانه‌ها از کشورهای خارج می‌گردد. برای سازندگی و به جهت ساختن این قطعات در آینده لازم است در حال حاضر جزئیات و روش ساخت و مشخصات آنها را کاملاً روشن کنیم و بر ضرورت تحقیق جامع عمل بپوشانیم.

از میان المانها، المان وریستور اکسید روی موضوع بحث پایان نامه اینجانب قرار گرفته که اثر تغییرات فشار پرس و دمایی سیسترنینگ روی خواص الکتریکی آلایش یافته با اکسید لانتانیم بررسی می‌شود. که با استفاده بیش از پنجاه منبع تحقیقاتی (کتب، جزووه، مقالات فارسی و لاتین) و نیز نتایج کارهای عملی و آزمایشگاهی و از آن مهمتر راهنمایی‌ها استادان راهنما و مشاور به رشتہ تحریر در آمده است. امید است منبعی برای تحقیقات و ساخت قطعه وریستور باشد.

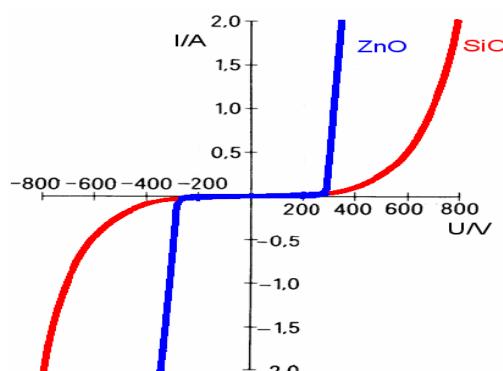
پایان نامه مذکور در چهار فصل نگارش یافته که فصل اول به بررسی منابع وریستور از نظر ساختمان، روش‌های تهییه و کاربرد و نقش مواد در قطعه وریستور می‌پردازد. فصل دوم آشنایی با وریستور است که مجموعه‌ای از تعاریف و مفاهیم، توصیف و انواع آن، ریزساختارها و فازهای تشکیل یافته، مرز دانه‌ها، اثر افزودنی، خواص الکتریکی و تئوری رسانش وریستور به طور اجمع نگرشی داشته است. در فصل سوم به عنوان پیشینه وریستورها، تحقیقات و نتایج به دست آمده توسط مقالات و پایان نامه که تا به حال کار شده است، را مطرح ساخته ایم. در فصل چهارم که نتایج کارهای عملی و آزمایشگاهی است کلیه مراحل ساخت وریستور اکسید روی آلایش یافته با اکسید لانتانیم به مقادیر میزان غلظت  $5/0\%$ ،  $1\%$ ،  $1/5\%$  مولی و نتایج به دست آمده را بیان نمودیم.

از این مجموعه تابه حال دو مقاله با راهنمایی‌های استادان تنظیم گردیده که از آن جمله برای یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران به عنوان "بررسی اثر تغییرات دمای باز پخت بر روی خواص الکتریکی وریستورهای اکسید  $ZnO$  آلایش یافته با  $La_2O_3$ " و برای کنفرانس سالانه فیزیک ایران به عنوان "اثرافزودنی  $La_2O_3$  بر روی خواص الکتریکی وریستور  $ZnO$ "

## ۱-۱ مقدمه

وریستورهای اکسید فلز دستگاههای حفاظتی سریع شنت حالت جامد هستند. این قطعات سرامیکی مشخصه شدیداً غیر خطی را از خود بروز می‌دهند. و به همین خاطر در صنایع برق و الکترونیک به عنوان محافظ مدار در برابر ولتاژهای بزرگ ناخواسته و ناگهانی استفاده می‌شوند. وریستورها در محدوده وسیعی از ولتاژها از چند ولت تا صدها کیلو ولت و جریانهای میکروآمپر تا چند کیلوآمپر کاربرد دارند [۲، ۵]. وریستورهای اکسید روی آلایش یافته با پلیمرها امروزه به عنوان برقگیر در خطوط انتقال و توزیع نیرو به کار می‌روند [۳، ۶].

اولین وریستور در سال ۱۹۶۱ با استفاده از بلورهای سیلیسیوم کاربید<sup>۱</sup> ساخته شد ولی وریستورهای سرامیکی اکسیدروی در سال ۱۹۶۸ در ژاپن توسط ماتسوکا و همکارانش ساخته شد و به علت مشخصات بهتر جایگزین سریع وریستورهای سیلیسیوم کاربید شد. شکل ۱-۱ زیر مقایسه‌ای بین این دو گزینه است.



شکل ۱-۱ مقایسه بین بلورهای سیلیسیوم کاربید و اکسیدروی

در یک دهه بعد از کشف وریستورهای اکسید روی<sup>۲</sup> افزودنیهای مناسبی پیدا شد. که مشخصات الکتریکی وریستورها را بهبود بخشد و شرایط ساخت وریستورها نیز بهینه شد. در دهه بعد ریز ساختار و خواص فیزیکی مرز دانه‌ها تعیین شده و در آن هنگام این وریستورها به سرعت کاربردهای خود را در ابزارهای محافظت از مدارهای قدرت و سیستمهای الکتریکی و حتی مدارهای مجتمع پیدا کرد [۵۳، ۴، ۱]. وریستورهای اکسید روی آلایش یافته با افزودنیهای مناسب سرامیکهای چند مؤلفه‌ای هستند که ریزساختار آنها شامل بلورهای کوچک اکسید روی (نیمرسانا) و مرزهای بین دانه‌ای عایق است که

<sup>۱</sup>SiC

<sup>۲</sup>Zinc Oxide Varistors

جهت گیری دانه ها و مرز دانه ها کاملاً تصادفی بوده و در نتیجه در تمام جهات مشخصه همگنی دارد. وریستورهای اکسیدروی که امروزه به عنوان برقگیر در خطوط انتقال و توزیع نیرو به کار می روند، از ماده اولیه اکسیدروی به همراه مقادیر جزئی عناصر افروزنی از جمله اکسیدهای بیسموت، منگنز، کروم، لانتانیم، پلیمرها و... تهیه شده اند. در صد مواد آلایش یافته در اکسید روی متفاوت است. و این آلایش باعث بروز مشکلات در خواص اکسید روی خالص می شود [۳، ۶].

در این تحقیق بیشتر به بررسی اثر تغییرات فشار پرس و دمای باز پخت روی خواص الکتریکی وریستورها اکسید روی با افزودنی اکسید لانتانیم که تا بحال کمتر کار شده است، مورد مطالعه قرار دادیم. از آنجائی که برای بهبود خواص الکتریکی بخصوص افزایش ضربی غیر خطی، پایداری، طول عمر و کاهش جریان نشتی، غیر از اکسید لانتانیم باید از اکسیدهای دیگری نیز استفاده کرد، مع الوصف دیگر منابع تحقیق اکسیدهای روی، پراسئودیمیوم، کروم، کبات را در نظر گرفتیم.

به منظور دستیابی به پودر اکسید روی با خلوص مطلوب و آلایش شونده های شیمیائی به تکنولوژی بالایی نیاز است. که سالیانه میلیونها دلار صرف واردات وریستورها از کشورها خارج می گردد. برای سازندگی و به جهت ساختن این قطعه در آینده لازم است در حال حاضر جزئیات و روش ساخت و مشخصات آن را کاملاً روشن کنیم و ضرورت تحقیق جامع عمل پوشانیدن با اهداف بالاست.

## ۱-۲ روی واکسید روی

اکسید روی با کاربرد روز افزونش جایگاه بهتری را در ساخت عناصر الکترونیکی پیدا کرده است. در این بخش برای شناخت کافی از اکسید روی درباره فنرزوی در سطح آشنایی مطالبی آورده و بعد در رابطه با اکسید روی و روش تهیه، ساختمان بلوری و همچنین کاربرد آن توضیح داده ایم.

## ۱-۲-۱ ساختمان روی

روی طبیعی در ۴ ایزوتوب پایدار تشکیل شده است،  $zn - 64$ ،  $zn - 66$ ،  $zn - 67$ ،  $zn - 68$ ،  $zn - 69$  که در این میان  $zn - 64$  فراوانترین آنها (۴۸٪ فراوانی طبیعی) می باشد. برای این عنصر ۲۲ رادیو ایزوتوب اکتیو شناسایی شده است، که در میان آنها  $zn - 65$  با نیمه عمر<sup>۱</sup> ۲۴۴/۲۶ روز و  $zn - 12$  با نیمه عمر<sup>۲</sup> ۴۶/۵ ساعت پایدارترین و فراوانترین ایزوتوب می باشد. دیگر ایزوتوبهای رادیو اکتیو این عنصر نیمه عمرهای کمتر از ۱۴ ساعت و بیشتر آنها نیمه عمر کمتر از یک دقیقه دارند این ۴ حالت متأ<sup>۳</sup> دارد [۵۴]. فنر روی سمی نیست. اما حالت‌های به نام ارتعاش روی<sup>۴</sup> و یا روی خنك<sup>۵</sup> وجوددارد که با استنشاق

<sup>۱</sup> Half- Life

<sup>۲</sup> Meta States

<sup>۳</sup> Zinc Skakes

<sup>۴</sup> Zinc Chills

اکسید روی تازه و خالص تحریک می شوند. روی فلزی است که در فولاد مورد استفاده قرار می گیرد و مانند فلزات دیگر به آرامی واکنش نشان می دهد. با اکسیژن و دیگر غیر فلزات ترکیب شده با اسید رقیق واکنش نشان داده گازهیدروژن آزاد می کند [۵۰].

## ۱-۲-۲ اکسید روی

اکسید روی از لحاظ الکتریکی یک رسانای نوع n است [۸]. ماده ای است به رنگ سفید که بلور آن بصورت شش وجهی و وزن مخصوص آن  $5 \text{ g/cm}^2$  است. و در دمای  $1800^\circ\text{C}$  درجه سانتیگراد شروع به تصفید می کند. ولی نقطه جوش آن  $1975^\circ\text{C}$  درجه سانتیگراد گزارش شده است. اکسید روی خالص در اثر گرمای زرد در می آید. ولی پس از سردشدن دوباره سفید می شود. در آب و الکل حل نمی شود ولی در اسیدها و بازها قابل حل است [۳۳].



شکل ۱-۳ پودر اکسید روی



شکل ۱-۲ تصویری از سنگ روی

اکسید روی یک ماده جالب با رابطه ضریب هدایت با ساختار شش وجهی سولفید روی متبلور می شود. تشکیل پیوند اکسید روی ترکیبی یون الکتریکی واکوالانسی است. خلوص بالای نشانه بلورهای نارسانا است. جریان الکتریکی نسبت به دیگر سرامیکهای شناخته شده غیر خطی تر است. وجود اکسیدهای همانند باریم و کروم باعث خواص الکتریکی غیر خطی زیاد می کند [۴۵].

## ۱-۲-۳ ساختمان بلوری اکسید روی

ساختار کریستالی اکسید روی از نوع شش وجهی<sup>۱</sup> روی سولفید است که در آن اتمهای اکسیژن در یک شبکه هگزاگونال فشرده قرار گرفته اند. و اتمهای روی نصف مواضع چهار وجهی را اشغال کرده اند. مواضع اتمهای اکسیژن و روی از نظر تعداد برابرند زیر هر کدام از اکسیژن و روی ها به صورت چهار وجهی همدیگر را هماهنگ<sup>۲</sup> می کنند. یعنی هر اتم روی تا چهار اتم اکسیژن همسایه نزدیک است و بر

<sup>۱</sup> Hexagonal Wurtzite

<sup>۲</sup> Coordination